



Технический семинар

«Технология наноимпринта для массового производства наноструктур»

Уважаемые господа,

Возможность коммерциализации изделий, основанных на элементах с нанометровыми размерами, в большой степени зависит от наличия экономически эффективного метода создания наноизображений на подложке с их дальнейшим преобразованием в наноструктуры. Одним из таких методов является технология наноимпринта (НИ), основанная на передаче наноразмерного рисунка в резист при помощи механического оттиска с использованием соответствующего штампа. Наноимпринт устойчиво передает элементы рельефа с характерными размерами менее 10 нм. По совокупности параметров разрешения, себестоимости и производительности эта технология успешно конкурирует с традиционными литографическими методами такими как фотолитография и электроннолучевая литография.

Шведская компания Obducat AB (Обдукат, www.obducat.com) первой вышла на рынок установок для наноимпринта еще в 2001 году и с тех пор занимает лидирующее положение в мире по количеству единиц поставленного оборудования. В 2008 году НИ оборудование, произведенное компанией, впервые стало использоваться для крупномасштабного производства оптоэлектронных LED устройств.

Специалисты фирмы «Обдукат» обладают уникальным опытом получения нанообъектов, используя способ нанооттиска, и готовы поделиться им с заинтересованными сторонами в форме технического семинара.

Семинар проводится Obducat AB совместно с российской компанией НТК Авант при поддержке Российского Научного Центра «Курчатовский Институт».



Установки НИ Eitre® на 76 и 150 мм размер подложек

Научно-техническая компания «Авант» и компания Obducat AB приглашают Вас принять участие в семинаре по технологии наноимпринта.

Семинар состоится 12 марта (четверг) 2009 г. по адресу: г. Москва, пл. Курчатова, д.1, Российский Научный Центр «Курчатовский Институт».

Семинар будет проводиться в желтом здании с колоннами, которое расположено на пл. Курчатова. Это здание является ближайшим к памятнику И.В.Курчатова и расположено от него (памятника) приблизительно в 50-70 метрах.

**Программа технического семинара
«Технология наноимпинта для массового производства наноструктур»
на 12 марта 2009 г.**

10:00 10:05	Вступительное слово (Курчатовский Институт, Гурович Б.А.)
10:05 10:35	Erik Marnung: “Obducat Company Introduction” - Company background - Activites and focus areas - Main technologies/patents - NIL industrialization road map
10:35 11:20	Erik Marnung: “Introduction to Nanoimprinting” - What is NIL? - Obducat technologies and comparison with other approaches - Working principles behind Obducat's NIL approach
11:20 12:00	Erik Marnung: “Obducat NIL for R&D” - Obducat's NIL offer for R&D - Details on Global Customer References and example of usage/results
12:00 12:30	Кофе
12:30 13:00	Marc Beck: “Possibilites and limitations for NIL” - Practical limitations to NIL - Possibilites for NIL compared to conventional lithography - Stamp manufacturing and anti-adhesion treatment - Use of various resists and materials
13:00 14:00	Marc Beck: “NIL applications” - Usage of NIL in display components, HDDs/magnetic storage media, high brightness LEDs, MEMS/NEMS etc - Results from our customer trials
14:00 14:30	Marc Beck: “Obducat NIL for HVM ” - Details on Obducat's solution for HVM production of High Brightness LED's - Sindre HVM machine presentation
14:40 15:10	Алексей Л. Богданов, Канадский Центр Оптоэлектронного Производства, Оттава, Канада, “Интеграция наноимпинта в структуру производства изделий с наноразмерами”
15:10	Вопросы-ответы, обсуждение

Доклады с переводом на русский язык. Для посещения семинара необходимо зарегистрироваться. Заявки на посещение семинара направляйте по адресу:

info@ntkavant.com

Участие в семинаре бесплатное.